



# EB描画実践セミナー

2016年2月19日 於 産業技術総合研究所

文部科学省委託事業「ナノテクノロジープラットフォーム」の一環として、『EB描画実践セミナー』を2016年2月19日（金）産業技術総合研究所にて開催いたします。電子ビーム露光技術の基礎から描画のためのデータ処理技術について、初心者にも分かり易く解説します。また、最新の露光装置を使った事例を紹介しますので、より具体的なイメージを持つことができると思います。

このセミナーに併設して“データ処理ソフトの使い方”についての無料実習コースを準備いたしました。露光実験を検討されている皆様に、是非一度使っていただきたいと思います。また、実際の露光装置を使った実習プログラムも用意しています。産学官いずれのご所属の方にも、広くご参加をお待ちしております。

**※無料実習のみの参加はできません。**

講義日時：2016年2月19日（金）9:55-12:30

場所：産業技術総合研究所 中央第2事業所 OSL棟（2-12棟）第6会議室

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba\\_map\\_c.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html)

参加費：無料

定員：60名（先着順、1/8より申し込み受け付け開始、参加登録をお願いします）

<https://nanoworld.jp/npf/training/h27-5/index.html>

## 【プログラム】

9:55 開会

9:55-10:00 『はじめに』

産総研 多田哲也

10:00-11:00 『電子ビーム露光の基礎』

東京工業大学 宮本恭幸

11:00-11:30 『電子ビーム露光における近接効果』

産総研 有本 宏

11:30-12:00 『電子ビーム描画のための様々なデータ処理技術』

GenISys 竹村 等

12:00-12:30 『微細加工プラットフォームの紹介と実施機関からの最新露光装置を使った事例』

東京大学 島本直伸

## 実習コースのご案内

### 【データ処理ソフトの使い方】

「GenISys社のBeamer：露光データ処理ソフトウェアを使って、近接効果補正、パターン分割最適処理、輪郭分離処理などのEB露光特有のデータ処理ソフトについて、初心者にもわかり易く教えます。また、持参されたデータを使って実際に変換を行うことも可能です。また、下記の描画実習コースに応募して比較露光を実施することもできます。」

場所：東京工業大学大岡山キャンパス

応募人数：8名（4名づつ2回実施）

実習期間：3時間／各実習（2月23日（火）午前4名、午後4名）

受講料：無料



電子メール

tia-npf-school4@aist.go.jp

（裏面へ続く）

# 【EB描画実習プログラム】

## 産総研（クレステックCABL-9410TFNA）

「データのボリュームによりますが、持ち込みデータの露光も可能です。」

応募人数：2名

実習期間：2日間（日程は受講者と協議 3月中に実施）

受講料：無料

## 東京工業大学（日本電子JBX-6300SJ）

「近接効果補正露光。持ち込みデータの露光も可能です。」

応募人数：4名（2名/日）

実習期間：1日（2回実施）（日程は受講者と協議 3月16日、17日）

受講料：無料

## 北海道大学（エリオニクスELS-F125）

「データのボリュームによりますが、持ち込みデータの露光も可能です。」

応募人数：2名

実習期間：2日間（日程は受講者と協議 3月中に実施）

受講料：無料

## 東京大学（アドバンテストF7000S）

「描画ソフトを用いたCP露光データ変換から、当方提供のパターンによるお試し露光」

応募人数：4名

実習期間：2日間（日程は受講者と協議 3月中に実施）

受講料：無料

### 主催：

産総研ナノプロセシング施設(NPF)

東京工業大学

量子ナノエレクトロニクス研究センター

### 共催：

東京大学 微細加工プラットフォーム

北海道大学 微細加工プラットフォーム

ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(TSC)



電子メール

tia-npf-school4@aist.go.jp